## 12 Атомно-силовой/туннельный микроскоп и его применение для исследования диэлектрического пробоя алмазной пленки на кремнии

## © А.В. Ермаков, В.К. Адамчук

Научно-исследовательский институт физики С.-Петербургского государственного университета, Петродворец

Поступило в Редакцию 12 августа 1997 г. В окончательной редакции 12 октября 1998 г.

Реализована простая конструкция атомно-силового микроскопа, где сила взаимодействия острия с поверхностью образца регистрируется непосредственно с помощью пьезокерамики X, Y, Z-манипулятора. Сигнал силы используется в качестве сигнала обратной связи при поддержании постоянным промежутка острие-поверхность, при этом одновременно регистрируется его электропроводность.

Приводятся результаты модификации электропроводности тонкой алмазной пленки после электрического пробоя.

Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) [1] и атомно-силовой микроскоп (АСМ) [2] в настоящее время получили признание как высокоэффективные средства для исследования поверхностных дефектов атомарного масштаба, однако каждый из них имеет свою, строго определенную сферу применения.

Туннельные микроскопы, обладающие пространственным разрешением порядка 1 Å в плоскости образца и порядка 0.05 Å по нормали к поверхности, показывают исключительно высокую чувствительность к точечным дефектам на поверхности [3,4]. Однако в основе принципа работы СТМ лежит условие электропроводности поверхности и наличие диэлектрических участков на поверхности полностью исключает возможность использования этого прибора.

Силовые микроскопы работают как на проводящих, так и на диэлектрических поверхностях, но чувствительны только к дефектам

80

существенно большего размера, чем точечные, например, таким как ступеньки и многоатомные вакансии [5,6].

В последние годы для решения конкретных задач физики, химии и техники реализовано большое количество различных конструкций СТМ и АСМ. В настоящей работе предложен принцип прибора, который может работать в режимах АСМ и СТМ, а также при сканировании в режиме АСМ позволяет производить регистрацию туннельного тока. Сила, возникающая между острием и поверхностью, регистрируется тем же пьезоманипулятором, который отслеживает Z, Y, X координаты. В реализованной на практике конструкции прибора острие закреплено непосредственно на пьезоманипуляторе и для регистрации малых сил взаимодействия острия с поверхностью используется электрический сигнал, возникающий в пьезоманипуляторе в результате воздействия силы.

Блок-схема прибора приведена на рис. 1. В режиме АСМ прибор работает следующим образом. На пьезокерамическую пластину (ПП), на которой закреплен образец (О), с помощью генератора переменного напряжения (ГПН) подается частота основного механического резонанса пьезоманипулятора (ПМ), что вызывает малые колебания образца по оси Z. Вследствие колебаний величины зазора острие-образец возникает осциллирующая сила взаимодействия острия с поверхностью образца, причем чем меньше зазор образец-острие, тем больше сила взаимодействия и амплитуда осцилляции силы. Поскольку острие жестко закреплено на пьезоманипуляторе, осцилляция силы взаимодействия остриеобразец вызывает механические колебания на резонансной частоте и электрический сигнал в пьезоманипуляторе (ПМ). Возникающий электрический сигнал далее выделяется трансформатором (Т) и передается в блок управления перемещением острия по оси Z (БУ). Блок управления в зависимости от поступающего сигнала вырабатывает и подает на ПМ напряжение низкой частоты (Uz), управляющее зазором острие-образец таким образом, что амплитуда колебаний переменного напряжения поддерживается постоянной при сканировании острия вдоль поверхности. В этом случае величина сигнала Uz отображает топографию поверхности. Поскольку сигнал, вырабатываемый пьезокерамикой (ПМ) на ее резонансной частоте, измеряется в цепи сигнала Uz, необходимо исключить частоты, близкие к резонансной частоте из сигнала Uz. С этой целью дополнительно к обычным компонентам типичной схемы обратной связи АСМ/СТМ (вычитание заданного уровня, интегратор



Рис. 1. Блок-схема прибора: 1 — основание, 2 — пьезоманипулятор, 3 — пьезокерамическая пластина, 4 — малошумящий селективный усилитель, 5 — блок управления перемещением Z, 6 — генератор переменного напряжения, 7 — компьютер, 8 — туннельный ток, 9 — усилитель туннельного тока, 10 — генератор импульсов, 11 — пробой, 12 — сканирующий туннельный микроскоп.

и высоковольтный усилитель). Блок управления (рис. 2) содержит фильтр нижних частот восьмого порядка с частотой среза 2 kHz, а также использован двухполупериодный амплитудный детектор, который позволяет подавить на несколько порядков выходной сигнал на резонансной частоте. С целью выделения сигнала резонансной частоты на фоне низкочастотного сигнала Uz полоса пропускания МСУ ограничена полосовым фильтром шестого порядка в пределах 20–30 kHz.

Перемещение острия по координатам X и Y осуществляется по программе с помощью компьютера. Одновременно со сканированием в режиме ACM можно производить регистрацию туннельного тока. Для этого на образец подается напряжение с источника (V). При прохождении острия над электропроводными участками возникает туннельный ток, который передается в компьютер, и на основе этого вырабатывается



**Рис. 2.** Блок-схема блока управления: ДД — двухполупериодный детектор, ФНЧ-фильтр нижних частот, *Us* — источник образцового напряжения, "-" — схема вычитания, ВИ — высоковольтный интегратор.

изображение. Следует заметить, что данное изображение будет отличаться от изображения, полученного в традиционной конструкции СТМ, так как в обратной связи использован не сигнал туннельного тока, а сигнал силы. Это позволяет одновременно регистрировать поверхности (через сигнал силы) и неоднородности электропроводности. Если сигнал туннельного тока подать в блок управления перемещением по Z, который будет поддерживать зазор острие-образец таким образом, что туннельный ток остается постоянным, прибор будет работать как СТМ.

Пьезокерамическая пластина ПП, на которой закреплен образец, изготовлена из пьезокерамики ПКР-6. Она имеет толщину 2 mm и ее пьезомодуль составляет 2.5 Å/V. В качестве пьезоманипулятора ПМ использован стержень крестообразного сечения длиной 90 mm, изготовленный из пьезокерамики ПКР-7М. Частота основного продольного резонанса равна 25 kHz. Согласно спецификации пьезокерамики марки ПКР-7М, чувствительность к силе на резонансной частоте составляет 2 V/N. Напряжение электрических шумов, приведенное ко входу трансформатора T, не превышает 5 nV, что соответствует амплитуде колебаний силы  $2.5 \cdot 10^{-9}$  N. Максимальное поле сканирования составляет 200 × 200  $\mu$ m.

Прибор был использован для модификации тонкой алмазной пленки посредством диэлектрического пробоя и исследования полученной поверхностной структуры. В данном эксперименте нами были использованы кремниевые пластины толщиной 0.2 mm с нанесенной на их поверхность алмазной пленкой толщиной 200 Å. Проводимость исходной пленки по всей сканируемой площади отсутствовала.



Рис. 3. Результат локального диэлектрического пробоя алмазной пленки.

Для осуществления диэлектрического пробоя образец подключался к генератору импульсов, а острие заземлялось. Мы использовали вольфрамовое острие, изготовленное с помощью электрохимического травления. Радиус острия, определенный с помощью электронного микроскопа, составлял  $\sim 0.3\,\mu{\rm m}$ . Зазор между образцом и острием соответствовал силе  $\sim 10^{-8}$  N. Путем воздействия на образец электрическими импульсами различной амплитуды и длительности с последующим контролем проводимости алмазной пленки на данном участке было установлено, что пороговое напряжение пробоя составляет 60 V, что соответствует напряженности поля  $3\cdot 10^6$  V/cm. Длительность импульсов варьировалась в пределах  $0.1-10\,\mu{\rm s}.$ 

С помощью электронного микроскопа было установлено, что форма острия практически не изменяется во время пробоя и оно может быть использовано впоследствии для сканирования образца.

На рис. 3, a приведено изображение, полученное в режиме атомносилового сканирования участка с диэлектрическими пробоями в четырех местах. Более светлые участки изображения осответствуют большей высоте. Из рисунка видно, что в местах пробоя появились выпуклости высотой  $\sim 100$  Å и с максимальным размером  $\sim 800$  Å в плоскости X - Y.

На рис. 3, *b* приведено распределение туннельного тока, измеренного одновременно со сканированием профиля, показанного на рис. 3, а. Из рис. 3, b видно, что в местах пробоя появилась электропроводная фаза. Более светлые участки изображения соответствуют большей проводимости. Размер проводящих участков, как видно из рисунков, существенно больше размеров выпуклостей, образовавшихся в местах пробоя. Исследуемый участок образца многократно сканировался в течение 12 дней. Полученные изображения показали хорошую воспроизводимость, что говорит о том, что полученные структуры стабильны и процесс сканирования не разрушает поверхность исследуемого образца.

Предложенная конструкция прибора существенно проще традиционной конструкции АСМ, так как исключает необходимость использования микропружины и устройств для измерения ее отклонения. Кроме того, закрепление острия непосредственно на пьезоманипуляторе устраняет нестабильное поведение острия на пружине при определенных расстояниях острие-образец [7] и позволяет устанавливать любое заданное расстояние острие-образец, что делает возможным одновременную регистрацию туннельного тока.

Работа выполнена в рамках Российской государственной программы "Перспективные технологии и устройства микро- и наноэлектроники" (проект № 039.04.223/57/2-3/1-95) и Федеральной целевой программы "Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки" (проект № 32642).

## Список литературы

- [1] Binnig G., Rohrer H., Gerber Ch., Weibel // Phys. Rev. Lett. 1982. V. 49. N 1. P. 57-68.
- [2] Binnig G., Quate S.F., Gerber Ch. // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 56. N 9. P. 930-933.
- [3] Binnig G., Rohrer H., Gerber Ch., Weibe E. // Phys. Rev. Lett. 1982. V. 50. N 2. P. 120-123.
- [4] Hahn J.R., Kang H. // Phys. Rev. B. V. 53. N 4. P. R1725-1728.

- [5] Binnig G., Gerber Ch., Stoll E., Albrecht T.R., Quate C.F. // Europhys. Lett. 1987. V. 3. N 12. P. 1281–1286.
- [6] Nickolayev O., Petrenko V.F. // J. Vac. Sci. Technol. 1994. B12(4). P. 2443-2450.
- [7] Sarid Dror, Ellings Vrgil // J. Vac. Sci. Tecnol. 1991. B 9. N 2. P. 431-437.